

「Rapidus が目指す先端半導体製造の現状と課題」

～ 精密プロセスを支える管理・制御技術 ～

講師紹介

Rapidus 株式会社 常務執行役員

赤堀 浩史（あかほり ひろし）氏



1993年に株式会社東芝に入社後、半導体事業の研究開発部門にて、生産技術（ユニットプロセス・インテグレーション・検査計測）・先端デバイスの開発を担当。2017年に東芝四日市工場（現・キオクシア株式会社 四日市工場）の生産技術部長として、生産技術、歩留改善業務に加え、2019年より副工場長としてビッグデータを活用した半導体製造のスマート化に取り組む。2021年より、同社の全体の DX 化推進を担当。2024年に日本セミラボ株式会社の副社長を経て、同年 6 月に Rapidus 株式会社に入社し、現職に就く。現在は北海道千歳市の開発拠点である IIM のオペレーションを担当。
博士（工学）東北大学。名古屋大学低温プラズマ科学研究センター、客員教授。

講演概要

先端デバイスの製造においては、原子・分子レベルに及ぶ極めて高い精度と、そのプロセス再現性が求められます。本講演では、その実情を概観するとともに、精密プロセスを実現する上で、不可欠となる「管理する技術」、そして「制御する技術」の重要性について解説いたします。しかしながら、その実現には多くの技術的な課題が存在します。その課題を具体的にお伝えすると共に、アカデミア並びに学会との連携が果たす大きな役割と、その期待について述べます。さらに、Rapidus が描く半導体産業の未来像にも触れ、産業全体が向かうべき方向性について展望いたします。

開催概要

日時：2026年3月17日(火) 13:30～14:30 (シンポジウム:14:30～16:00)

会場：埼玉大学 全学講義棟1号館 3F301（春季大会会場内）

申込方法：<https://2026-03spring.jspe.or.jp/semiconductor-sympo/>

または、右の QR コードからお申込み下さい。

参加費：無料（会員、非会員を問いません）、事前申込制



*本基調講演後、半導体製造技術関連のシンポジウムを行います。

【連携企画】新技術講演会（技術賞受賞講演）：16:15～17:45（予定）

同会場にて開催します。併せてご参加ください。